

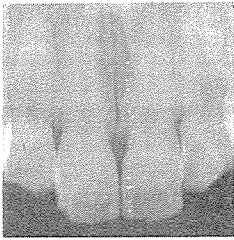
법랑질 발육부전(Enamel Hypoplasia)

법랑질의 형성은 기질의 생성과 이것의 석회화로 이루어 지는데 법랑질의 기질생성이 어떤 국소적 또는 전신적 원인에 의해 장애를 받은 경우, 법랑질의 표면에 불규칙성이나 결손을 보이는데 이를 “법랑질 발육부전”이라 하고 석회화에 이상이 있는 것을 “법랑질 석회화 부전”이라 한다.

법랑질의 발육기형은 법랑질 무형성증, 법랑질 형성부전증, 과 법랑질 발육부전으로 구분되어 진다. 법랑질 발육부전의 원인은 영양결핍, 선천성매독, 저칼슘증, 출생시의 손상, 국소적 감염이나 외상, 특발성 요인 등이며, 치아 발육기간에 이들이 법랑아세포의 활동을 방해 함으로서 법랑질 발육부전이 생긴다. 법랑질 발육부전의 양상은 법랑아세포가 영향받는 시기에 따라 전체 치아 또는 몇개의

치아에 발생하며 호발부위는 절치, 소구치, 제 1 대구치 순이며 일반적으로 유치열보다 영구치열에서 많이 나타난다. 유치열에서는 용혈성 질환을 앓고 난 유아, 핵황달을 동반한 조산아와 뇌성마비 환자 등에서 법랑질 발육부전을 관찰할 수 있다.

방사선상은 해부학적 이상에 따라서 다르게 나타나므로 판독이 불가능한 경우가 많으며 이상이 가벼운 증례에서는 법랑질의 변화를 판독할 수 없으나 치관의 근심 또는 원심면에 소와나 작은 함몰상이 관찰된다. 또 심한 경우 교합면이나 절단면에 일련의 구형의 검은상이 치아를 일직선으로 가로지르는 듯한 상을 보이고, 치질의 결여가 있는 곳은 뚜렷한 방사선 투과상이 국소화되어 나타난다.



정우치과기공소
Jung Woo Dental Lab.